

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 27 年 5 月 28 日 (2015.5.28)

【公開番号】特開 2015-71530 (P2015-71530A)

【公開日】平成 27 年 4 月 16 日 (2015.4.16)

【年通号数】公開・登録公報 2015-025

【出願番号】特願 2014-181852 (P2014-181852)

【国際特許分類】

C 0 1 B 33/04 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 33/04

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 4 月 8 日 (2015.4.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

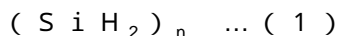
金属元素の含有量が 0 . 0 1 ~ 1 0 0 p p bであることを特徴とする高純度シクロヘキサシラン。

【請求項 2】

ナトリウムの含有量が 0 . 0 1 ~ 1 0 0 p p bである高純度シクロヘキサシラン。

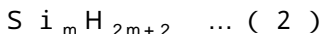
【請求項 3】

不純物を含む水素化シラン化合物から金属元素の含有量が 0 . 0 1 ~ 1 0 0 p p bである高純度水素化シラン化合物を得る製造方法であって、高純度水素化シラン化合物が、下記式 ( 1 )



(式 ( 1 ) 中、n は 3 ~ 6 である。)

または下記式 ( 2 )



(式 ( 2 ) 中、m は 3 ~ 6 である。)

で表され、少なくとも、条件の異なる蒸留工程を 2 回以上行うことを特徴とする高純度水素化シラン化合物の製造方法。

【請求項 4】

短行程蒸留、薄膜式蒸留、分子蒸留のいずれかによる第 1 蒸留工程と、蒸留塔での第 2 蒸留工程を行う請求項 3 に記載の製造方法。

【請求項 5】

第 1 蒸留工程を 25 ~ 80 で行い、第 2 蒸留工程を第 1 蒸留工程より高温で、かつ、50 ~ 100 で行う請求項 3 または 4 に記載の製造方法。

【請求項 6】

第 1 蒸留工程を 3 k P a ~ 1 0 P a で行う請求項 4 または 5 に記載の製造方法。

【請求項 7】

クロムの含有量が 0 . 0 1 ~ 1 0 p p b である高純度シクロヘキサシラン。

【請求項 8】

カリウムの含有量が 0 . 0 1 ~ 1 0 p p b である高純度シクロヘキサシラン。